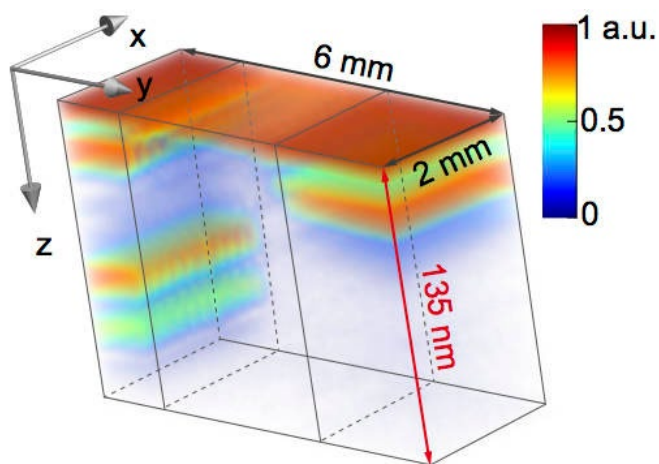


极紫外和软x射线辐射EUV显微镜 (Metrology计量学 无损亚纳米级次表面成像)



产品描述:

三维无损成像技术在材料科学和医学等许多应用领域都非常重要。我们开发了一种成像技术, 利用极紫外和软x射线辐射来获得纳米分辨率的横截面图像。

例如, 我们能够无损地研究硅片或生物样品中的近表面结构。

在下边的图片中, 你可以看到几个埋在硅下的金层。它们的位置可以用我们的计量仪测量, 精度低于1nm。这些层位于表面下的110 nm和128 nm处。

产品特点:

- 无损成像
- 反射成像
- 轴向分辨率(厚度) < 30 nm
- 轴向位置精度 < 1 nm
- Max深度 < 1 μ m
- 高材料对比度
- 易于安装样品

